

应用场景

- 刻蚀设备、薄膜沉积设备（PVD & CVD）

特点和指标

- 密封面粗度行业领先，TM/LL/PM（传输腔 / 过渡腔 / 反应腔）一站式供应
- 腔体涂层有阳极 /APS/ 刷镍三种能力
- 刻蚀反应腔体高温阳极密封能力



Chamber

关键参数	Vital
密封面粗度	Ra < 0.2μm
膜厚均一性	± 5% μm
BDV	> 600 V/mil
漏率	< 1E - 11 torr. L/min
遮蔽工艺界限	≤ ± 0.2mm
高温He检能力	具有
腔体涂层	阳极 / APS / 刷镍
腔体类型	PM / TM / LL

技术能力		
技术模块	能力	参数
加工/制造	最大覆盖尺寸	3.6m
	精度	< 0.01mm
	焊接	TIG / MIG
材料	腔体材质	AL / SUS
	氦漏	< 10^ - 9Mbar L/S